【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和6年1月26日(2024.1.26)

【公開番号】特開2022-119371(P2022-119371A)
【公開日】令和4年8月17日(2022.8.17)
【年通号数】公開公報(特許)2022-150
【出願番号】特願2021-16443(P2021-16443)
【国際特許分類】
Ｇ０５Ｂ 19/418(2006.01)
Ｇ０３Ｆ 7/20(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 21/027(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０５Ｂ 19/418 Ｚ
Ｇ０３Ｆ 7/20 ５２１
Ｈ０１Ｌ 21/30 ５６９
Ｈ０１Ｌ 21/30 ５６４

【手続補正書】
【提出日】令和6年1月18日(2024.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１タイミングで基板を処理する基板処理装置が基板を処理した処理結果と、前記第１タイミングの後の第２タイミングで前記基板処理装置に発生したイベントに関するイベント情報と、前記第２タイミングの後の第３タイミングで前記基板処理装置が基板を処理した処理結果と、を含む情報を取得する取得部と、
前記基板処理装置に発生したイベントを選択できる選択部と、
前記取得部で取得した情報に基づいて、前記第１タイミング及び前記第３タイミングでの処理結果を含む処理結果を時系列に並べたグラフを表示装置へと表示するように制御する表示制御部と、を有し、
前記表示制御部は、前記選択部で選択されたイベントが発生したタイミングを示す情報を前記グラフに重畳して表示させることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
前記表示制御部は、前記選択部で選択されていないイベントが発生したタイミングを示す情報を前記グラフに重畳して表示させないことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
前記イベント情報は、前記基板処理装置を構成する各ユニットを初期化するリセットに関する情報、前記基板処理装置の動作を制御するパラメータの変更に関する情報、ユーザが前記基板処理装置に所定の動作をさせるためのコマンドに関する情報、基板に転写する回路パターンが描かれているレチクルの交換に関する情報のうち、いずれか１つを含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
前記表示制御部は、前記第２タイミングを示す線を前記グラフに重畳して表示させることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。

【請求項５】
前記表示制御部は、異なる種類のイベントに対しては、前記線の色及び前記線の形状の少なくとも一方を変更して表示させることを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
前記取得部は、複数の基板処理装置による処理結果を取得し、
前記表示制御部は、前記複数の基板処理装置のそれぞれの処理結果を、異なる領域にそれぞれグラフ表示させることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
前記取得部は、複数の基板処理装置による処理結果を取得し、
前記表示制御部は、前記複数の基板処理装置のそれぞれの処理結果を、複数の基板処理装置の間で共有して設定される処理条件であるレシピ別に分類して、レシピ別に異なる領域にグラフ表示させることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
前記表示制御部は、前記第２タイミングを示す情報を、レシピ別に異なる領域に表示されたグラフにそれぞれ重畳して表示させることを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
前記取得部は、基板単位における処理結果を取得し、
前記取得部で取得した基板単位における処理結果に基づいて、複数の基板が属するロット単位における処理結果を算出する算出部を更に有することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
前記算出部は、基板単位における処理結果の最大値、最小値、平均値、中央値、標準偏差値のうちのいずれか１つの統計値に基づいて、複数の基板が属するロット単位における処理結果を算出することを特徴とする請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
前記表示制御部は、複数の基板が属するロット単位における処理結果を時系列に並べてグラフ表示させることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
第１タイミングで基板を処理する基板処理装置が基板を処理した処理結果と、前記第１タイミングの後の第２タイミングで前記基板処理装置に発生したイベントに関するイベント情報と、前記第２タイミングの後の第３タイミングで前記基板処理装置が基板を処理した処理結果と、を含む情報を取得する取得工程と、
前記基板処理装置に発生したイベントを選択できる選択工程と、
前記取得工程で取得した情報に基づいて、前記第１タイミング及び前記第３タイミングでの処理結果を含む処理結果を時系列に並べたグラフを表示装置へと表示するように制御する表示制御工程と、を有し、
前記表示制御工程は、前記選択工程で選択された前記基板処理装置に関するイベントが発生したタイミングを示す情報を前記グラフに重畳して表示させることを特徴とする情報処理方法。
【請求項１３】
請求項１２に記載の情報処理方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１４】
請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の情報処理装置と、
基板上にパターンを形成するパターン形成装置と、を含み、
前記情報処理装置は、前記パターン形成装置を含む複数の装置を管理することを特徴と

する物品の製造システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の製造システムを用いて基板上にパターンを形成する形成工程と、
　前記形成工程でパターンが形成された基板に対して、酸化、成膜、蒸着、ドーピング、平坦化、エッチング、レジスト剥離、ダイシング、ボンディング、パッケージングの内、少なくとも１つの処理を行う処理工程と、を含み、
　前記処理工程で処理された基板から物品を製造することを特徴とする物品の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面としての情報処理装置は、第１タイミングで基板を処理する基板処理装置が基板を処理した処理結果と、前記第１タイミングの後の第２タイミングで前記基板処理装置に発生したイベントに関するイベント情報と、前記第２タイミングの後の第３タイミングで前記基板処理装置が基板を処理した処理結果と、を含む情報を取得する取得部と、前記基板処理装置に発生したイベントを選択できる選択部と、前記取得部で取得した情報に基づいて、前記第１タイミング及び前記第３タイミングでの処理結果を含む処理結果を時系列に並べたグラフを表示装置へと表示するように制御する表示制御部と、を有し、前記表示制御部は、前記選択部で選択されたイベントが発生したタイミングを示す情報を前記グラフに重畳して表示させることを特徴とする。